## アリールシリルアルキル側鎖基を有する 電子欠損性半導体ポリマーの開発

(山形大院有機) 〇佐藤宇覧・Zi-En Jiang・Wen-Ya Lee・東原知哉\*

【要旨】 In this work, we developed a novel n-type semiconducting polymer with arylsilylalkyl side chains. Indeed, the objective n-type naphthalene-diimide(NDI)-based polymer, P(NDISiC6-PhT2), could be synthesized by the Stille coupling polymerization of the NDI-based dibromo monomer with 2,5-distannylthiophene. In the UV-Vis spectroscopy, P(NDISiC6-PhT2) in the chloroform solution showed a blue-shift compared to other two polymers, P(NDISiC8-T2) and P(NDI2DT-T2); on the other hand, P(NDISiC6-PhT2) in the thin film state showed a red-shift probably due to the existence of the phenyl groups at the side chain end. The GIWAXS measurement revealed that the P(NDISiC6-PhT2) thin film possessed more edge-on rich crystalline structures compared with the P(NDISiC6-PhT2) thin film exhibited a high mobility ( $\mu_e = 0.1 [\text{cm}^2/\text{V/s}]$ ) due to the excellent crystalline structure and its edge-on-rich orientation provided by the phenyl groups at the side chain terminal, despite of its relatively low number average molecular weight ( $M_n = 7,700$ ).

【緒言】有機薄膜トランジスタ(OTFT)は柔軟・軽量・安価といった利点がある。近年、 電荷移動度向上のため、側鎖基の開発が注目されている。側鎖基は剛直な主鎖骨格に溶 解性を付与するだけでなく、分子パッキング、薄膜モルフォロジー、およびデバイスに 応用した際の電荷移動度等の半導体特性に大きな影響を与えることが分かっている<sup>1,2</sup>。 したがって、高い電荷移動度の獲得には適切な側鎖基の分子設計が求められる。中でも 効果的なアプローチとして、側鎖の分岐点を主鎖から遠ざける分子設計が知られている <sup>3</sup>。この設計では良好な溶解性を維持しつつ、主鎖のパッキングを高められる工夫がな

されている。我々はこの設計方針 に従い、アルキルシリルアルキル 側鎖基を有するπ共役系高分子 材料の開発に成功している<sup>4,5</sup>。 しかしながら、この種の側鎖基に おいて側鎖末端にフェニル基を 導入した報告例は未だない。側鎖 末端へフェニル基を導入するこ とで、主鎖と側鎖によるπ-πス タッキングの相乗効果により、結 晶性や結晶配向性の向上が期待 できる。また、フェニル基への置 換基導入により、ポリマーの表面



Scheme 1. Synthesis of P(NDISiC6-PhT2).

自由エネルギーを自在に制御できる可能性がある。以上より、本研究ではアリールシリ ルアルキル側鎖基を有する新規 π 共役系高分子材料の開発を目的とし、合成、結晶構造 解析および光・電子特性の評価を行った。

【実験】Scheme1 に示す通り、目的のポリマーP(NDISiC6-PhT2)の合成は Stille カップ リング重縮合法を用いて行った。得られたポリマーの構造解析および特性評価には<sup>1</sup>H-NMR、<sup>13</sup>C-NMR、FT-IR スペクトル、UV-Vis スペクトルおよび GIWAXS 測定を用いた。

【結果と考察】P(NDISiC6-PhT2)(M<sub>1</sub>=7,700, Đ=1.17)は Stille カップリング重縮合により 得られた(Scheme 1)。また、P(NDISiC8-T2)および P(NDI2DT-T2)を比較ポリマーとして 用い、諸物性評価を行った(Figure 1)。

UV-Vis スペクトル測定では、全てのポ リマーは溶液状態(クロロホルム)およ び薄膜状態において、二つの特徴的なピ ークを示した。短波長側の吸収ピークは π-π\*遷移、長波長側の吸収ピークはド ナー部からアクセプター部への分子内・ 分子間電荷輸送(ICT)にそれぞれ帰属さ れる。また、溶液状態に比べて薄膜状態 における最大吸収波長が大きく長波長 シフトしていることが分かった(Figure

**2, Table 1**)。これは 薄膜状態の方が主 鎖の平面性が高 く、分子配向性が 向上したためと考 察している。 P(NDISiC6-PhT2) に着目すると、溶

液および薄膜状態 において興味深い



Figure 1. The chemical structures of P(NDISiC6-PhT2), P(NDISiC8-T2) and P(NDI2DT-T2).



Figure 2. UV-vis spectra for P(NDISiC6-PhT2), P(NDISiC8-T2) and P(NDI2DT-T2) in chloroform solutions and thin films.

挙動を示した。P(NDISiC6-PhT2)は溶液状態において他の二つのポリマーP(NDISiC8-T2), P(NDI2DT-T2)と比較して最も大きくブルーシフトしている一方で、薄膜状態にお いては最も大きくレッドシフトした(Figure 2, Table 1)。このことから、P(NDISiC6-PhT2) は、溶液中では分子内・分子間相互 Table 1. Summary of optical properties for P(NDISiC6-作用が弱く、主鎖の有効共役長が短 PhT2), P(NDISiC8-T2) and P(NDI2DT-T2). いと推察される。この点は、クロロ  $\lambda_{max}$  (film) λ..... (sol.) ホルム溶液中での溶解性が [nm]<sup>a</sup> とと合致する。一方、薄膜ロ

ホルム溶液中での溶解性か高いこ		[nm]	[nm] <sup>a</sup>
とと合致する。一方、薄膜中ではπ	P(NDISiC6-PhT2)	365, 610	395, 718
平面性が向上したため、分子内・分		555, 515	555,725
子間相互作用が強まったと考えら	P(NDISiC8-T2)	368, 624	391, 693
れる。これは <b>P(NDISiC6-PhT2)</b> の側	P(NDI2DT-T2)	370, 642	396, 709
鎖末端に導入したフェニル基の影	*The thin films are annealed at 150°C.		

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議

響が大きいためと推定できる。特に、薄膜中では側鎖末端のフェニル基によりポリマー 主鎖間の相互作用に加えて側鎖間も相互作用すると考えられ、有効共役長が最も延長し たと考察できる。以上の結果から、側鎖末端へのフェニル基導入は、塗布系の電子デバ イス用途に効果的であり、固体状態において良好なパッキングを誘引できることから、 優れた半導体特性を示すと期待される。今回、側鎖末端の置換基がポリマーの光学特性 に大きく影響を与えることが明らかになったことは大変意義深い。

次に、斜入射広角 X 線散乱(GIWAXS)法を用いて結晶構造解析を行った結果、

P(NDISiC6-PhT2)および P(NDISiC8-T2)薄膜 はいずれも基板に対して垂直なedge-on配向性 を示した(Figrues 3, 4)。対照的に、P(NDI2DT-T2)薄膜はedge-onとface-onの両方の配向性を 示すことが分かった(Figures 3, 4)。これは、側 鎖の分子鎖長、分岐様式、および側鎖末端の化 学構造が異なることにより、薄膜状態における ポリマー鎖のパッキングの仕方に違いが生じ たためと考察している。次に、一次元画像から

面内方向(in-plane)における *π*-*π* stacking 間距離を求め た。P(NDISiC6-PhT2)および **P(NDI2DT-T2)**薄膜の π - π stacking 間距離はそれぞれ 0.386 [nm]および 0.403 [nm] と求まった。一方、 P(NDISiC8-T2)薄膜に関し ては、(010)の $\pi$ - $\pi$  stacking 由 来のピークが確認されなか ったため、*π*-*π* stacking 間距 離は算出できなかった (Table 2)<sub>o</sub> P(NDISiC6-PhT2) 薄膜は P(NDI2DT-T1)薄膜 と比較して短い π - π stacking 間距離を示した。 P(NDI2DT-T1)は、分岐点 が主鎖に近いため、ポリマ ー間の*π*-*π*相互作用が阻 害されやすい。一方、 P(NDISiC6-PhT2) は 側 鎖







**Figure 4.** 2-D GIWAXS patterns and orientation images for annealed thin films of **P(NDISiC6-PhT2)**, **P(NDISiC8-T2)** and **P(NDI2DT-T2)** at 200 °C after casting from chloroform solutions.

Table 2. Crystallographic parameters of polymer thin films.

	P(NDISiC6-PhT2)	P(NDISiC8-T2)	P(NDI2DT-T2)
Lamellar spacing (nm)	2.88 (q <sub>z</sub> )	2.74 (q <sub>z</sub> )	2.21 (q <sub>z</sub> )
π-π stacking distance (nm)	0.386 (q <sub>xy</sub> )		0.403 (q <sub>xy</sub> ), 0.388 (q <sub>z</sub> )

の分岐点が主鎖から離れているため、ポリマー間のπ-π相互作用が阻害されにくい。 その結果、分子間相互作用が増加し、π-π stacking 間距離が短くなったと考えられる。 次に一次元画像から面外(out-of-plane)方向の lamellar spacing 間距離を求めた。その結果、 三つのポリマー薄膜 P(NDISiC6-PhT2)、P(NDISiC8-T2)および P(NDI2DT-T2)は、それ ぞれ 2.88 [nm]、2.74 [nm]、および 2.21 [nm]の lamellar spacing 間距離を示した(Table 2)。 一般に、面外方向の lamellar spacing 間距離は側鎖構造に依存する。そのため、炭素数の 少ない分岐側鎖を有する P(NDI2DT-T2)が最も小 さい値を示したと考えられる。また、P(NDISiC8-T2)の方が P(NDISiC6-PhT2)より若干小さい lamellar spacing 間距離を示した。側鎖の炭素数は 後者の方が小さいことを考慮すると、P(NDISiC8-T2)の方が P(NDISiC6-PhT2)に比べ、側鎖間でより 密に嵌合構造を形成していると考えられる。 P(NDISiC8-T2)薄膜では、上述の通り、(010)のπ-

N2200.

 $\pi$  stacking 由来のピークが確認されなか ったことから、密な嵌合構造がむしろ主 鎖の $\pi$ - $\pi$ 相互作用を弱めているとも考 えられる。

最後に、得られたポリマー薄膜の OTFT 特性評価を行ったところ、 P(NDISiC6-PhT2)薄膜は $\mu_e = 0.1 [\text{cm}^2/\text{V/s}]$ の優れた電子移動度を示した。この値は 代表的な NDI ポリマーである N2200 (Figure 5,  $\mu_e = 0.071 [\text{cm}^2/\text{V/s}]$ )と比較し ても高く、P(NDISiC6-PhT2)薄膜の優れ た結晶構造および高い edge-on 配向性が **Table 3.**Summary of OTFT performances forNDI-based polymers.

Solution	P(NDISiC6-PhT2)		N2200	
Solvent	СВ	CF	СВ	CF
On/Off	2x10 <sup>2</sup>	1x10 <sup>2</sup>	1x10 <sup>3</sup>	6x10 <sup>3</sup>
V <sub>th</sub> (V)	25	23	26	25
μ <sub>e</sub> <sup>max.</sup> (cm <sup>2</sup> V <sup>-1</sup> s <sup>-1</sup> )	0.1	0.071	0.061	0.088
CB=chlorobenzene CF=Chloroform				

電子移動度に大きく寄与したと考えられる(Table 3)。

以上の OTFT デバイス特性評価により、アリールシリルアルキル側鎖基の有効性が示 された。アリールシリルアルキル側鎖基はポリマーに良好な溶解性を付与するだけでな く、結晶性や結晶配向性を効率的に高めることができることが分かった。また、側鎖末 端へのフェニル基の導入は電荷移動度向上に大きな役割を果したことが明らかとなっ た。

【結論】本研究では、アリールシリルアルキル側鎖基を導入した新規電子欠損性半導体 高分子の合成に成功した。側鎖基の形状がポリマー薄膜の光学特性および結晶形態に大 きく影響を与えることが明らかになった。また、側鎖末端へのフェニル基導入はポリマ ーの結晶性を効率的に高め、P(NDISiC6-PhT2)薄膜を使用した OTFT デバイス評価では  $\mu_e = 0.1 [cm^2/V/s]$ の優れた電子移動度を示した。

謝辞:半導体高分子薄膜の GIWAXS 測定は、小金澤智之博士のご協力の下、SPring-8 (BL46XU, proposal No. 2018A1794)にて行われた。

## 参考文献:

[1] J. Fréchet and co-workers. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 19229.

- [2] D. Y. Kim and co-workers. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 2758.
- [3] Z. Bao and co-workers. Chem. Mater. 2014, 26, 604.
- [4] T. Higashihara, W. C. Chen and co-workers. *Macromolecules* 2016, 49, 8540.
- [5] T. Higashihara, W. C. Chen and co-workers. *Macromolecules* 2019, 52, 4396.